

NR74g 3000PY光刻胶 北京赛米莱德有限公司

产品名称	NR74g 3000PY光刻胶 北京赛米莱德有限公司
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶按用途分类

光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为印刷电路板(PCB)用光刻胶、液晶显示(LCD)用光刻胶、半导体用光刻胶和其他用途光刻胶。其中，PCB光刻胶技术壁垒相对其他两类较低，而半导体光刻胶代表着光刻胶技术水平。

(1)半导体用光刻胶

在半导体用光刻胶领域，光刻技术经历了紫外全谱(300~450nm)、G线(436nm)、I线(365nm)、深紫外(DUV, NR74g 3000PY光刻胶厂家, 包括248nm和193nm)和极紫外(EUV)六个阶段。相对应于各曝光波长的光刻胶也应运而生，光刻胶中的关键配方成份，如成膜树脂、光引发剂、添加剂也随之发生变化，使光刻胶的综合性能更好地满足工艺要求。

(2)LCD光刻胶

在LCD面板制造领域，光刻胶也是极其关键的材料。根据使用对象的不同，可分为RGB胶(彩色胶)、BM胶(黑色胶)、OC胶、PS胶、TFT胶等。

光刻工艺包含表面准备、涂覆光刻胶、前烘、对准曝光、显影、坚膜、显影检查、刻蚀、剥离、终检查等步骤，以实现图形的转移，制造特定的微结构。

想要了解更多光刻胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

光刻胶

在曝光过程中，正性胶通过感光化学反应，切断树脂聚合物主链和从链之间的联系，达到削弱聚合体的目的，所以曝光后的光刻胶在随后显影处理中溶解度升高。曝光后的光刻胶溶解速度几乎是未曝光的光刻胶溶解速度的10倍。而负性胶，在感光反应过程中主链的随机十字链接更为紧密，并且从链下坠物增长，所以聚合体的溶解度降低。见正性胶在曝光区间显影，负性胶则相反。负性胶由于曝光区间得到保留，漫射形成的轮廓使显影后的图像为上宽下窄的图像，NR74g 3000PY光刻胶公司，而正性胶相反，为下宽上窄的图像。

想要了解更多光刻胶的相关信息，NR74g 3000PY光刻胶，欢迎拨打图片上的热线电话！

光刻胶可以分为哪几类

光刻胶的技术复杂，品种较多。根据其化学反应机理和显影原理，可分负性胶和正性胶两类。光照后形成不可溶物质的是负性胶。反之，NR74g 3000PY光刻胶多少钱，对某些溶剂是不可溶的，经光照后变成可溶物质的即为正性胶。

赛米莱德以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售光刻胶，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

NR74g 3000PY光刻胶-北京赛米莱德有限公司由北京赛米莱德贸易有限公司提供。北京赛米莱德贸易有限公司是北京大兴区工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛米莱德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛米莱德更加美好的未来。